

Symposia	開催日	Presentation number	開始	終了	講演題目	発表者	所属
B1	28, June	1B101	10:20	10:25	B1セッションオープニング		
	28, June	1B102	10:25	10:45	2,2'-ジ(トリフルオロメチル)ベンジジンとトリメリット酸無水物から誘導されるジカルボン酸と脂環式ジアミンからなる高透明ポリアミドイミドの合成	*芝崎 祐二[1]、小林 優太郎[1]、藤原 ゆみ[1]、塚本 匡[1]、大石 好行[1]	1. 岩手大学
	28, June	1B103	10:45	11:05	テトラフェニレン骨格を有するジアミンからのポリイミドの合成と、その性質のテトラフェニレン骨格を有する酸二水物からのポリイミドとの比較	*森川 敦司[1]	1. 茨城大学
	28, June	1B104	11:05	11:25	再配線用低温硬化型低誘電率および誘電正接ポリイミド	*壽慶 将也[1]、荒木 斉[1]、小笠原 央[1]、嶋田 彰[1]、藤原 健典[1]、富川 真佐夫[1]	1. 東レ株式会社 電子情報材料研究所
	28, June	1B105	11:25	11:45	表示体向け感光性材料の開発	*田中 義人[1]、高橋 泰典[1]、井上 和紀[1]	1. 住友ベークライト株式会社 情報通信材料研究所
	28, June	1B106	11:45	12:05	新規な熱塩基発生剤を用いる低温イミド化によるポリイミドフィルムの作製	*引田 二郎[1,2]、伊熊 直彦[1]、塩田 大[1]、塚本 匡[2]、芝崎 祐二[2]、大石 好行[2]	1. 東京応化工業株式会社、2. 岩手大学
	28, June	1B107	12:40	13:00	ダブルデッカー型シルセスキオキサンを主鎖に有するポリイミドの合成と特性	*神谷 奨[1]、井本 裕顕[1]、中 建介[1]	1. 京都工芸繊維大学
	28, June	1B108	13:00	13:20	鎖長制御されたポリシロキサンを含むポリイミドの合成および高次構造解析	*吉田 絵里菜[1]、難波江 裕太[1]、早川 晃鏡[1]	1. 東京工業大学
	28, June	1B109	13:20	13:40	沈殿重合法によるポリイミド微粒子の作製	*樽谷 仁志[1]、難波江 裕太[1]、早川 晃鏡[1]	1. 東京工業大学
	28, June	1B110	13:40	14:00	脂肪族ジアミンとテトラアザリックス[2]アレーン[2]トリアジンジクロリドを用いた半脂環式ポリグアナミンの合成と特性	*芝崎 祐二[1]、佐々木 晴基[1]、柴田 亮太[1]、塚本 匡[1]、大石 好行[1]	1. 岩手大学
	28, June	1B111	14:00	14:20	フェニルメラミン骨格を有するポリグアナミンの合成と特性	*塚本 匡[1]、芝崎 祐二[1]、大石 好行[1]	1. 岩手大学
	28, June	1B112	14:20	14:25	B1セッションクロージング		
B2	30, June	3B201	9:30	9:55	ビニル基系有機シリコン原料を用いたPECVD法によるSiO <sub>2</sub> :CH微粒子堆積膜の作製	中泉 有稀[1]、*井上 泰志[1]、高井 治[2]	1. 千葉工業大学、2. 関東学院大学
	30, June	3B202	9:55	10:20	酸素プラズマを用いたカルボキシル基の均一修飾による小径長尺チューブ内腔へのバイオメテリックDLCの創成	*今井 裕一[1,2]、福江 紘幸[2]、中谷 達行[2]、國次 真輔[3]、神田 一浩[4]、鈴木 常生[5]、和田里 章悟[6]、藤井 泰宏[7]、逢坂 大樹[8]、大澤 晋[8]、内 富男[1]	1. ストロープ株式会社、2. 岡山理科大学、3. 岡山工業技術センター、4. 兵庫県立大学、5. 長岡技術科学大学、6. 岡山医療センター、7. 日本医療研究開発機構、8. 岡山大学
	30, June	3B203	10:20	10:45	熱アシスト大気圧グローブプラズマによるポリテトラフルオロエチレンの接着性の改善機構	*田中 邦翁[1]、佐藤 公哉[1]、高橋 和夫[1]、小駒 益弘[1]	1. 上智大学
	30, June	3B204	10:45	11:00	休憩		
	30, June	3B205	11:00	11:25	生体適合性高分子ブラン修飾によるDLC膜の表面機能化	*笹井 泰志[1]、逢坂 大樹[2]、藤井 泰宏[3]、磯野 蒼[1]、山内 行玄[4]、近藤 伸一[5]、中谷 達行[6]	1. 岐阜医療科学大学、2. 岡山大学学術研究院医歯薬学域、3. 日本医療研究開発機構、4. 松山大学、5. 岐阜薬科大学、6. 岡山理科大学フロンティア理工学研究所
	30, June	3B206	11:25	11:50	CYP1A2およびCYPレダクターゼのリン脂質自己組織化膜上への固定化とその活性評価	*近藤 伸一[1]、石井 綾乃[1]、土井 直樹[1]、笹井 泰志[2]、山内 行玄[3]、葛谷 昌之[1]	1. 岐阜薬科大学、2. 岐阜医療科学大学薬学部、3. 松山大学薬学部
	30, June	3B207	11:50	12:15	休憩		
	30, June	3B301	9:00	9:20	ウェハースケールマイクロ流路用低応力感光性接着剤の開発	*土井 貴史[1]、西村 功[1]、金子 将寛[1]、下川 努[1]	1. JSR株式会社
	30, June	3B302	9:20	9:40	コロイド結晶をテンプレートにした反射色を有するハイドロゲル膜の同定方法	*高山 捷匡[1]、岩田 直人[1]、古海 誓一[1]	1. 東京理科大学

B3	30, June	3B303	9:40	10:00	高解像性ノボラックレジストの合成	*関口 淳[1,5]、花畑 誠[2]、南 絃子[1]、松本 陽子[1]、太田 陽介[1]、Wang Fucheng[3]、Ma Martin[3]、Su Zhiqiang[4]	1. リソテックジャパン(株)、2. 大阪市立大学、3. 浙江自立高温科技股份有限公司、4. 北京化工技術大学、5. 大阪府立大学
	30, June	3B304	10:00	10:20	指紋センサ向け感光性高屈折率シロキサンの開発	*福岡 雄介[1]、藤井 真実[1]、諏訪 充史[1]	1. 東レ株式会社 電子情報材料研究所
	30, June	3B305	10:20	10:40	エーテル化されたヒドロキシプロピルセルロース誘導体が形成するコレステリック液晶の粘弾性挙動と光学特性	*松本 和真[1]、荻原 裕己[2]、岩田 直人[1,2]、古海 誓一[1,2]	1. 東京理科大学理学部第一部応用化学科、2. 東京理科大学大学院理学研究科化学専攻
	30, June	3B306	10:40	10:50	休憩		
	30, June	3B307	10:50	11:10	ジピリジルジスルフィド架橋モノマーの合成と異種材光接着への応用	*古谷 昌大[1]、千京 律斗[1]	1. 福井工業高等専門学校
	30, June	3B308	11:10	11:30	高分子鎖で表面修飾したシリカ微粒子によるコロイド結晶の形成	*松浦 佐和[1]、小原 舞美[2]、岩田 直人[1,2]、古海 誓一[1,2]	1. 東京理科大学理学部第一部応用化学科、2. 東京理科大学大学院理学研究科化学専攻
	30, June	3B309	11:30	11:50	ジアリアルアミノベンジリデンアニリンの酸応答発光色変化	塚田 琢真[1]、*中野 英之[1]	1. 室蘭工大
	30, June	3B310	11:50	12:10	ポリシラン-ピレンメタクリレート共重合体の合成	東出 侑里[1]、高岸 佑紀[1]、*松浦 幸仁[1]、大北 正信[2]、立川 友晴[2]	1. 奈良工業高等専門学校、2. 大阪ガスケミカル株式会社
B3-5	29, June	2B3-501	13:00	13:35	原子状水素アニールによる酸化膜の表面洗浄と表面改質 [招待講演]	*部家 彰[1]、住友 弘二[1]	1. 兵庫県立大学
	29, June	2B3-502	13:35	14:10	水/エタノール混合蒸気大気圧プラズマを用いたPTFE表面の処理と分析 [招待講演]	*八田 章光[1]、Fitriani Sukma[1]、古田 寛[1]、矢島 英樹[2]	1. 高知工科大学、2. オーク製作所
	29, June	2B3-503	14:10	14:30	回転円盤上での液膜形成と洗浄液分布に関する三次元シミュレーション	*神保 佳典[1]、水嶋 祐基[1]、真田 俊之[1]	1. 静岡大学工学部
	29, June	2B3-504	14:30	14:40	休憩		
	29, June	2B3-505	14:40	15:00	基板バイアス機構を有するマイクロ波励起水蒸気プラズマによるイオン注入レジストの高速アッシング	*相澤 洸[1,2]、櫻井 匡[1]、榎森 悠介[1]、Nyar Paing Khant[1]、中野 裕介[1]、田中 康規[1]、石島 達夫[1]	1. 金沢大学、2. (株)米倉製作所
	29, June	2B3-506	15:00	15:40	マイクロ波励起水蒸気プラズマによるポリマー薄膜のアッシング特性の検討 [招待講演]	*石島 達夫[1]、相澤 洸[1,2]、田中 康規[1]、堀邊 英夫[3]	1. 金沢大学、2. 米倉製作所、3. 大阪市立大学
	29, June	2B3-507	15:40	15:50	休憩		
	29, June	2B3-508	15:50	16:10	Investigation of Pressure Dependence in Photoresist Ashing Process using Microwave Excited Water Vapor Plasma	*Khint Nyar Paing[1]、Takeshi AIZAWA[1]、Hiroto NISHIOKA[2]、Masashi YAMAMOTO[2]、Tasuku SAKURAI[1]、Erdenezaya BAT-ORGIL[1]、Yusuke KAYAMORI[1]、Yusuke NAKANO[1]、Yasunori TANAKA[1]、Tatsuo ISHIJIMA[1]	1. Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa Univ., 2. National Institute of Technology, Kagawa College
	29, June	2B3-509	16:10	16:50	レーザー照射とオゾン水処理を用いたレジスト除去技術の開発 [招待講演]	*神村 共住[1]、小泉 敦司[1]、岡本 光司[1]、安國 良平[1]、吉村 政志[2]、堀邊 英夫[3]	1. 大阪工業大学、2. 大阪大学、3. 大阪公立大学

シンポジウム番号	シンポジウム名
B1	ポリイミド及び高温耐熱樹脂—機能化と応用—
B2	プラズマ光化学と高分子表面機能化
B3	一般講演
B3-5	レジスト除去、エッチング、洗浄